

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成27年3月12日(2015.3.12)

【公開番号】特開2014-114472(P2014-114472A)

【公開日】平成26年6月26日(2014.6.26)

【年通号数】公開・登録公報2014-033

【出願番号】特願2012-268381(P2012-268381)

【国際特許分類】

C 2 3 C 8/12 (2006.01)

C 2 5 C 1/12 (2006.01)

C 2 5 C 5/02 (2006.01)

C 0 1 G 3/02 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 8/12

C 2 5 C 1/12

C 2 5 C 5/02

C 0 1 G 3/02

【手続補正書】

【提出日】平成27年1月26日(2015.1.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

表面に酸化皮膜を有する電解銅粉を乾式で粉碎する乾式粉碎工程と、
この乾式粉碎工程によって得られる電解銅微粉末を酸化する酸化工程とを含み、
前記酸化皮膜は、銅イオン含有溶液の電気分解によって得られる電解銅粉を水洗した後
、酸素含有雰囲気において70～150の温度で乾燥することによって形成される、
酸化第二銅微粉末の製造方法。

【請求項2】

前記乾式粉碎工程は酸素含有雰囲気で行われる、請求項1に記載の酸化第二銅微粉末の
製造方法。

【請求項3】

前記酸化工程は、前記電解銅微粉末を300～700で熱することによって行われ
る、請求項1又は2に記載の酸化第二銅微粉末の製造方法。

【請求項4】

請求項1から3のいずれかに記載の製造方法によって得られる酸化第二銅微粉末が溶解
された硫酸銅水溶液を電解銅めっき装置の電解液として使用する、銅めっき方法。